InGaN 青色半導体レーザ励起チタン・サファイアレーザ

InGaN-semiconductor laser pumped Ti:Sapphire laser

慶大理工 澤井翔太, 河内比花留, 神成文彦

Keio Univ. Sawai Shota, Hikaru Kawauchi, Fumihiko Kannari

E-mail:kannari@elec.keio.ac.jp

はじめに チタンドープサファイア結晶は波長可変および超短パルスレーザとして最も広く使われている。しかし、励起には半導体レーザ(LD) 励起 Nd:YLF レーザの 2 倍高調波のような高出力緑色レーザが必要となるため、装置はコンパクトになりにくく、また安価にもならない。赤色 LD で直接励起可能なクロムドープ LiSAF, LiCAF 結晶はこれらの欠点を補える広帯域発振レーザであるが、高出力赤色 LD の汎用性の低さから未だ一般的ではなく、むしろ LD 励起 Yb 系による超高速レーザ開発が注目されている。近年、プロジェクター用に波長~440 nm 近傍での高出力 InGaN LD が開発され、チタン・サファイアの LD 直接励起が可能となってきた[1,2]。励起強度が 1W 程度の InGaN-LD を励起に用いた場合、レーザ結晶の FOM 値が 100 程度ではレーザの取り出し効率を高くできない。しかし、FOM 値を上げるためにドープ濃度を低下させると結晶長が長くなり LD 励起には適さない。我々は、励起強度~3 W を想定し厚さ 2.5 mm の結晶 (FOM~100)を使うことで、LD 直接励起チタン・サファイアレーザの開発に着手した。最終的には、半導体多重井戸過飽和吸収体(SESAM)を用いたフェムト秒レーザ発振を目標としている。

実験結果 まず 2 枚の凹面鏡と高反射率鏡、出力鏡からなる 4 枚鏡共振器を用いて CW 発生実験を行った。チタン・サファイア結晶は FOM>100, 厚さ 2.5 mm, 2 枚の凹面鏡の曲率半径は 50 mm, 励起には最大出力強度 3.5W の GaN-LD (Nichia 製)を用いた。その結果、最大出力 11.5 mW, スロープ効率 2.1%, 中心波長 785 nm を確認した。チタン・サファイアの吸収ピークは波長 500 nm 近傍にあり、また短波長で励起した場合には励起準位吸収も生じるため、レーザ特性は LD の駆動波長に大きく依存する。共振器中にチャープミラーを入れ、高反射率鏡を SESAM に変えることでパルス動作を試みた。

Fig.1 Experimental setup of direct GaN-LD pumped mode-lock Ti:Sapphire laser.

[1] Peter W. Roth et al., Opt. Lett. 34, 3334 (2009).

[2] Peter W. Roth et al., Opt. Lett. 36, 304 (2011).